

研究評価委員会
「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」(事後評価)分科会
議事要旨

日 時：平成27年6月18日(木) 9:30~18:15

場 所：WTC コンファレンスセンター Room A (世界貿易センタービル 3F)

出席者(敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長	鈴木 彰	国立研究開発法人 科学技術振興機構	イノベーション拠点推進部 戦略ディレクター
分科会長代理	澤田 廉士	九州大学 工学研究院 機械工学部門	教授
委員	岡田 至孝	東京大学先端科学技術研究センター	教授
委員	長澤 弘幸	株式会社 CUSIC	代表取締役
委員	新垣 実	浜松ホトニクス株式会社 中央研究所	理事/研究主幹
委員	廣瀬 圭一	株式会社 NTT ファシリティーズ 研究開発本部	主幹研究員
委員	三宅 常之	日経BP社 日経テクノロジーオンライン編集	副編集長

<推進者>

岡田 武	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	部長
吉木 政行	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	主幹
柚須 圭一郎	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	主査
間瀬 智志	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	PM

<実施者※メインテーブル着席者のみ>

奥村 元	産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター	センター長
和田 敏美	次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構	専務理事
氷見 啓明	産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター	
矢野 孝幸	新日鐵住金株式会社 技術開発本部先端技術研究所	部長
恩田 正一	株式会社デンソー 基礎研究所 機能材料研究部	部長
山川 聡	三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 SiC デバイス開発センター	センター長
松岡 利記	FCRA	専務理事
山東 睦夫	FCRA	技術部長

<評価事務局等>

中谷 充良	NEDO 技術戦略研究センター	主任研究員
佐藤 嘉晃	NEDO 評価部	部長
保坂 尚子	NEDO 評価部	主幹
成田 健	NEDO 評価部	主査

議事次第

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
2. 分科会の設置について
3. 分科会の公開について
4. 評価の実施方法について
5. プロジェクトの概要説明
 - 5.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」について
 - 5.2 「研究開発成果」及び「実用化・事業化の見通し」について
 - 5.3 質疑応答

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明
 - 6.1 高品質・大口径 SiC 結晶成長技術開発／革新的 SiC 結晶成長技術開発
 - 6.2 大口径 SiC ウエハ加工技術開発
 - 6.3 SiC エピタキシャル膜成長技術(大口径対応技術／高速・厚膜成長技術)
(共通基盤評価技術の成果を含む)
 - 6.4 SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術
 - 6.5 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発
7. 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み
8. 全体を通しての質疑

(公開セッション)

9. まとめ・講評
10. 今後の予定、その他
11. 閉会

議事要旨

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
 - ・配布資料確認 (事務局)
2. 分科会の設置について
 - ・研究評価委員会分科会の設置について、資料1に基づき評価事務局より説明。
 - ・出席者の紹介 (評価事務局、推進者)
3. 分科会の公開について
 - 評価事務局より資料 2 及び 3 に基づき説明し、議題 6.「プロジェクトの詳細説明」議題 7.「実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み」議題 8.「全体を通しての質疑」を非公開とした。
4. 評価の実施方法について
 - 評価の手順を評価事務局より資料 4-1～4-5 に基づき説明した。
5. プロジェクトの概要説明
 - (1) 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント
 - 推進者より資料6-1に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。
 - (2) 研究開発成果及び実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて
 - 実施者より資料6-2に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明
 - 6.1 高品質・大口径 SiC 結晶成長技術開発／革新的 SiC 結晶成長技術開発
 - 6.2 大口径 SiC ウエハ加工技術開発
 - 6.3 SiC エピタキシャル膜成長技術(大口径対応技術／高速・厚膜成長技術)
(共通基盤評価技術の成果を含む)
 - 6.4 SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術
 - 6.5 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発
7. 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み
 - 上記の説明に対し質疑応答が行われた。
8. 全体を通しての質疑

(公開セッション)

9. まとめ・講評
10. 今後の予定、その他
11. 閉会

配布資料

- 資料 1 研究評価委員会分科会の設置について
- 資料 2 研究評価委員会分科会の公開について
- 資料 3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘と非公開資料の取り扱いについて
- 資料 4-1 NEDOにおける研究評価について
- 資料 4-2 評価項目・評価基準
- 資料 4-3 評点法の実施について
- 資料 4-4 評価コメント及び評点票
- 資料 4-5 評価報告書の構成について
- 資料 5-1 事業原簿（公開）
- 資料 5-2 事業原簿（非公開）
- 資料 6-1 プロジェクトの概要説明資料（公開）
事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント
- 資料 6-2 プロジェクトの概要説明資料（公開）
研究開発成果、実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み
- 資料 7 プロジェクトの詳細説明資料（非公開）
- 資料 8 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み（非公開）
- 資料 9 今後の予定
- 参考資料 1 NEDO 技術委員・技術委員会等規程
- 参考資料 2 技術評価実施規程

以上